## ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ УДК 538.911

Дідоборець Олександр,

Коба Тарас

(Дніпро, Україна)

## МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО СПЕКТРІВ ФЛІККЕР - ШУМУ В ЕПІТАКСІАЛЬНИХ ПЛІВКАХ УВА<sub>2</sub>CU<sub>3</sub>O<sub>7</sub>.

Анотація: Моделюванням методом Монте-Карло процесів термообробки плівок YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub> показано, що для актуальних діапазонів частот і температур основними джерелами їх надлишкового фліккер-шуму є переходи кисню поблизу малокутових границь блоків.

Ключові слова: фліккер-шум, епітаксіальні плівки, шумовий параметр Хоуге, CuO-площина, малокутові границі блоків.

Annotation: Monte-Carlo modelling anneals of  $YBa_2Cu_3O_7$  epitaxial films have been carried out, and the excess flicker noise in the operating frequency and temperature ranges were shown to be dominated by oxyden migration near small-angle block boundaries.

**Key words:** flicker noise, epitaxial films, Hooge noise parameter, CuO-plane, small-angle block boundaries.

Фліккер-шумами (ФШ) називають шуми, інтенсивність яких збільшується при зменшенні частоти (f), наприклад, як 1/f. Інтенсивність ФШ, звичайно характеризують безрозмірним параметром Хоуге (*α*) [1].

Інтенсивність та спектр низькочастотного шуму(з залежністю, близькою до 1/f) епітаксіальних плівок YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub> є важливими параметрами, які визначають можливості ïχ застосування V різних пристроях високотемпературної надпровідної (ВТНП) електроніки, наприклад у болометрах. Відомо, що параметр α у цих плівках на багато порядків перевищує відповідні значення для плівок простих металів. Велика величина параметра Хоуге ( $\alpha > 10^{-3}$  при 93К) ВТНП пристроїв. Прийнятні величини невисоку конкурентність означає параметрів останніх можна одержати рахунок за високого значення

температурного коефіцієнта опору в області фазового переходу, але й у цьому випадку велика величина α не є сприятливою обставиною. Вона прогнозує швидку деградацію досягнутих параметрів, оскільки такі значення вказують на значну концентрацію метастабільних дефектів ВТНП плівок і на їхню інтенсивну низькотемпературну дифузію. У з'єднаннях YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub> такими дефектамифлуктуаторами (ДФ) є атоми кисню CuO площини. Дана робота присвячена комп'ютерному моделюванню методом Монте-Карло просторових розподілів атомів кисню СиО-площини і розрахункам енергій бар'єра їх переходу (спектрів ДФ) у найближчі вузли ґраток, що залежить від наявності і конфігурації розташування сусідніх атомів кисню, від режимів післяростових термообробок (стартової і кінцевої температур, швидкості їх зміни), від ступеня заповнення киснем CuO площини, від наявності одноосьової деформації і блоковості плівок YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub>. . Розподіл атомів кисню на CuO-площині було отримано за стандартною схемою Метрополіса методом Монте-Карло в рамках так званої ANNNI [2-4], що враховує взаємодії найближчих атомів кисню: 1) моделі взаємодії, що притягає, V<sub>2</sub> (~0,30 eB), яка зумовлена ковалентним зв'язком атомів кисню через орбіталі розташованого між ними атома міді і 2) відштовхувальних взаємодій  $V_1$  (~0,35 eB) і  $V_3$  (~0,05 eB) атомів кисню, розташованих у середині суміжних і протилежних ребер квадрату субргратки міді, відповідно (див. рис.1.).



Рис.1. Потенціали взаємодій атомів кисню СиО-площині. Великі кружки і квадрати - заповнена киснем і порожня підрешітки, темні кружки атоми міді.  $V_i \neq V_i$  ' при наявності деформації. Нумерація вузлів використовується для позначення відстаней між ними.

Імовірність *w<sub>ij</sub>* переходу атома в сусідній вакантний вузол *f* з вузла *i* визначається наступним співвідношенням

$$w_{if} = \begin{cases} 1, \quad \Delta V \leq 0\\ exp(-\Delta V / T), \quad \Delta V \geq 0 \end{cases} , \qquad (1)$$

де  $\Delta V = V_f - V_i$ ,  $V_f$  і  $V_i$  - сумарна енергія взаємодії атома кисню з оточенням у вихідному вузлі і після стрибка, відповідно. Були використані періодичні граничні умови.

Розподіли кисню розраховувалися шляхом модельної термообробки що починалася при високих температурах  $T_o$ , при яких хаотичний розподіл атомів кисню задавалося за допомогою генератора випадкових чисел, і закінчувалася при низькій температурі *Трів* відповідно до

$$T = T_0 \exp(-gn) + T_{piB_{.}} , \qquad (2)$$

де g - швидкість термообробки, n - число Монте-Карло кроків. Спектр енергій ДФ визначався шляхом підрахунку кількості бар'єрів з даною енергією для всіх пар позицій, з яких одна порожня, а друга зайнята атомом. Ці енергії розраховувалися в наближенні гармонійного потенціалу ями, мінімум якого розташований на позиції кисню, відповідно до процедури, запропонованої в [5]

$$E_{\delta} = V_o + (V_f - V_i) / 2 + (V_f - V_i)^2 / 16 V_o \quad , \tag{3}$$

де V<sub>0</sub> - висота бар'єра для ізольованого атома, у якого всі сусідні вузли порожні як до стрибка, так і після. Величина V<sub>0</sub> використовувалася як підгінний параметр. Її величина була рівною ~ 0.3 eB.

Комп'ютерне моделюванню розподілу атомів кисню поблизу границь блоків і розрахунок відповідних спектрів Д $\Phi$  дозволили встановити границі областей переважних джерел  $\Phi$ Ш на *f*-*T*- площині. Виявлено, що для актуальних частот і температур ВТНП мікроелектроніки основними джерелами цього шуму є Д $\Phi$ , розташовані поблизу малокутових границь блоків і інших двовимірних дефектів, енергія активації дифузії кисню поблизу яких < 0,5 еВ (див. рис.2).



Рис.2. Переважні джерела шуму на *f*-*T*-площині. Пунктирна пряма поділяє частотну вісь на область вимірів (*f*>1 Гц) і область деградаційних процесів

## ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

[1] Sh. Kogan. Electronic noise and fluctuations in solids. Univercity press. Cambridge (1996). 354p.

- [2] D. Fontaine, L.T. Wille, S.C. Moss. Phys. Rev. B36, 5709 (1987).
- [3] A.G. Khachaturyn, J.W. Morris, jr. Phys. Rev. Lett. 61, 215 (1988).

[4] M. Goldman, C.P. Burmester, L.T. Wille, R. Gronsky. Phys.Rev. B50, 1337 (1994).

[5] A.M. Bowler, E.S. Hood. J. Chem. Phys. 94, 5162 (1991).